

证书号第6391971号



发明专利证书

发明名称：一种高截留平板纳滤基膜及其制备方法

发明人：陈慧英;尹勇强;戴建辉;兰秀娟;洪昱斌;方富林;蓝伟光

专利号：ZL 2022 1 1028942.1

专利申请日：2022年08月25日

专利权人：三达膜科技（厦门）有限公司

地址：361000 福建省厦门市集美区杏林锦亭北路66号（主厂房）

授权公告日：2023年10月13日

授权公告号：CN 115475537 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



证书号 第6391971号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年08月25日前缴纳。
未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

三达膜科技（厦门）有限公司

发明人：

陈慧英;尹勇强;戴建辉;兰秀娟;洪昱斌;方富林;蓝伟光